

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開実用新案公報 (U)

(11) 実用新案出願公開番号

実開平7-31261

(43) 公開日 平成7年(1995)6月13日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

B 2 4 B 37/04

識別記号

Z 8813-3C

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数 1 F D (全 2 頁)

(21) 出願番号 実願平5-63619

(22) 出願日 平成5年(1993)11月2日

(71) 出願人 000003458

東芝機械株式会社

東京都中央区銀座4丁目2番11号

(72) 考案者 秦 晶一

静岡県沼津市大岡2068-3 東芝機械株式  
会社沼津事業所内

(72) 考案者 大石 俊夫

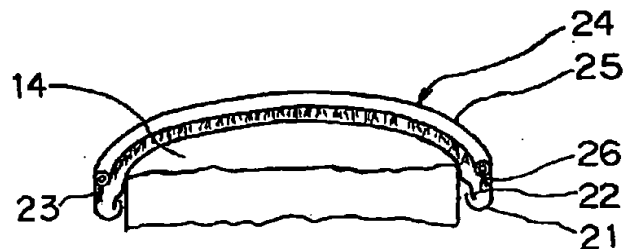
静岡県沼津市大岡2068-3 東芝機械株式  
会社沼津事業所内

(54) 【考案の名称】 ポリシング装置

(57) 【要約】

【目的】 ポリシング加工終了後の研磨液受け内に洗浄水を流し、残留している研磨液を洗い流すと共に、その後も残留している研磨液の固形化を防止し粉塵の発生を防止する。

【構成】 下定盤14の円周部に沿って設けた樋形状の研磨液受け21上部にポリシング加工終了毎に研磨液受け21内面に沿って洗浄水23を流す流水口26を有するリザーバ24を設けたポリシング装置である。この構成により研磨液受け21に残留した研磨液を殆んど洗い流すことができると共に、その後も残留している研磨液の乾燥を防止し固形化から発生する粉塵を防止する。



## 【実用新案登録請求の範囲】

【請求項 1】 下定盤と上定盤または加圧ヘッドとの間に半導体ウエハ等を装着し、前記下定盤と上定盤または加圧ヘッドをそれぞれ回転させ研磨液を供給しながら前記上定盤または加圧ヘッドで半導体ウエハ等を下定盤に押し付けポリシング加工を行うポリシング装置において、ポリシング終了後、前記研磨液の水路を洗浄水に切換えると同時に、前記下定盤の円周部に沿って設けた樋形状の研磨液受け上部に前記研磨液受け内面に沿って前記洗浄水とは別水路からの洗浄水を流す流水口を有するリザーバを設けたことを特徴としたポリシング装置。

## 【図面の簡単な説明】

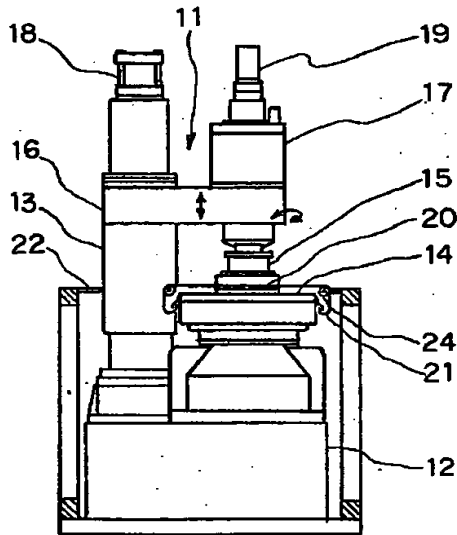
【図 1】 本考案によるポリシング装置の一実施例を示す側面図

【図 2】 本考案による要部断面斜視図

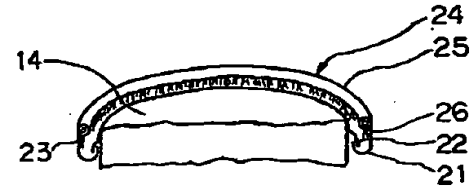
## 【符号の説明】

- 1 1 片面ポリシング装置
- 1 2 ベース
- 1 3 コラム
- 1 4 下定盤
- 1 5 チャック
- 1 6 アーム
- 1 7 駆動ヘッド
- 2 0 半導体ウエハ
- 2 1 研磨液受け
- 2 2 案内片
- 2 3 洗浄水
- 2 4 リザーバ
- 2 5 パイプ
- 2 6 小孔（流水口）

【図 1】



【図 2】



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開実用新案公報(U)

(11)実用新案出願公開番号

実開平6-3423

(43)公開日 平成6年(1994)1月18日

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>

B 0 1 D 46/00

46/12

// B 0 1 D 53/04

識別記号

3 0 2

庁内整理番号

7059-4D

7059-4D

Z

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数1(全 3 頁)

(21)出願番号

実願平4-49544

(22)出願日

平成4年(1992)6月22日

(71)出願人 000001122

国際電気株式会社

東京都港区虎ノ門2丁目3番13号

(72)考案者 渡辺 誠治

東京都港区虎ノ門2丁目3番13号 国際電  
気株式会社内

(72)考案者 小池 秀樹

東京都港区虎ノ門2丁目3番13号 国際電  
気株式会社内

(72)考案者 山本 哲夫

東京都港区虎ノ門2丁目3番13号 国際電  
気株式会社内

(74)代理人 弁理士 三好 祥二

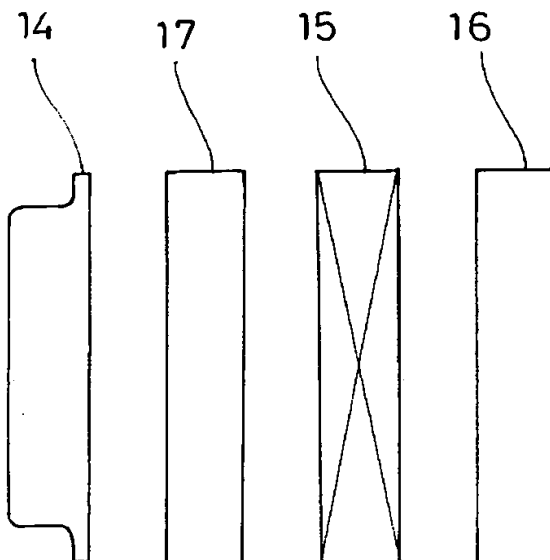
最終頁に続く

(54)【考案の名称】 半導体製造装置の空気清浄装置

(57)【要約】

【目的】半導体製造装置に吸引される空気を、塵埃のみならず燐或は弗化水素、塩化水素等の汚染物質を除去して空気を高度に浄化する。

【構成】微粒子除去用フィルタ15の上流側にケミカルフィルタ17を配設し、ケミカルフィルタより大きな塵埃を除去すると共に燐或は弗化水素、塩化水素を吸着し、微粒子除去用フィルタにより微細な塵埃を除去する。



1

2

【実用新案登録請求の範囲】

【請求項 1】 微粒子除去用フィルタの上流側にケミカルフィルタを配設したことを特徴とする半導体製造装置の空気清浄装置。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本考案の一実施例を示す概念図である。

【図 2】 縦型拡散・CVD装置の正面方向からの斜視図である。

【図 3】 縦型拡散・CVD装置の背面方向からの斜視図

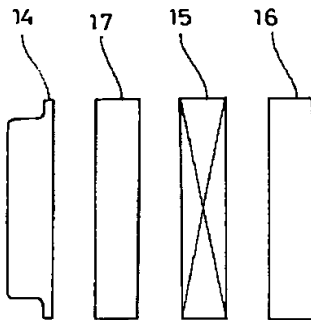
である。

【図 4】 従来例の斜視図である。

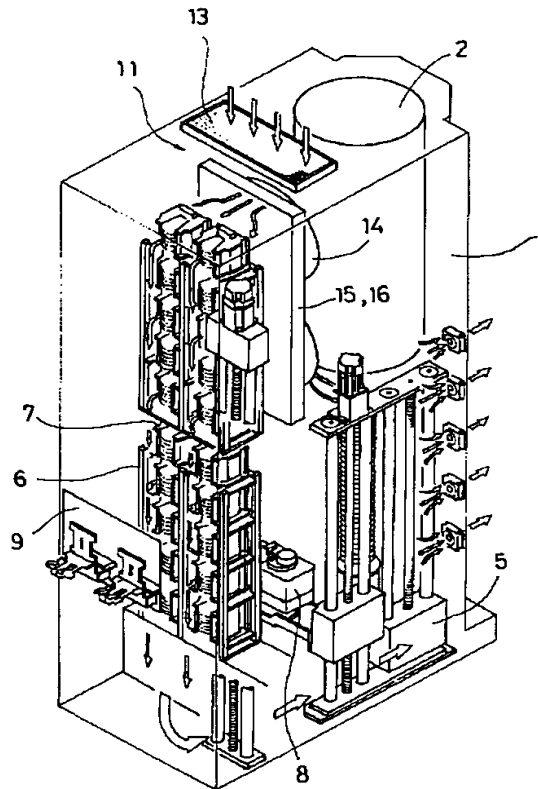
【符号の説明】

- 1 3 プレフィルタ
- 1 4 ファン
- 1 5 微粒子除去用フィルタ
- 1 6 フィン
- 1 7 ケミカルフィルタ

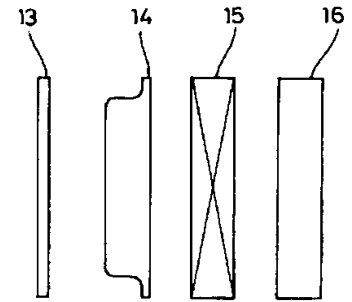
【図 1】



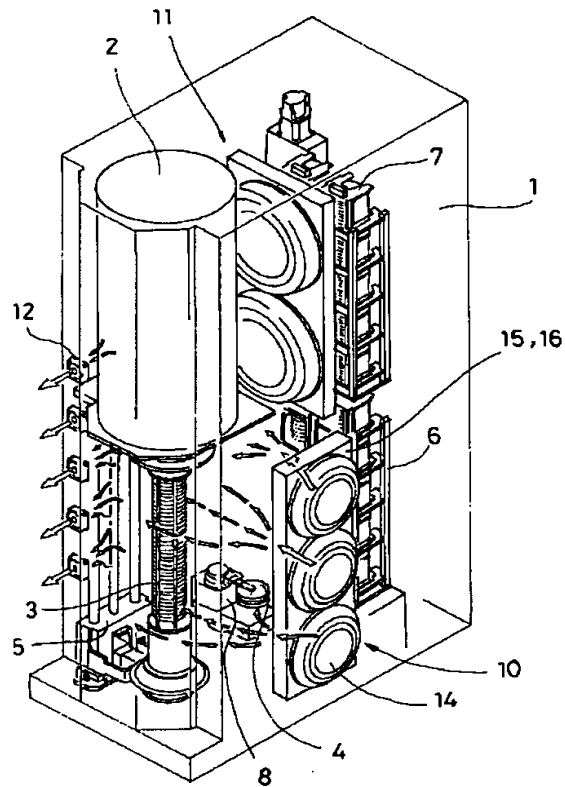
【図 2】



【図 4】



【図 3】



フロントページの続き

(72) 考案者 保坂 英二  
東京都港区虎ノ門二丁目 3 番 13 号 国際電  
気株式会社内

(72) 考案者 鈴木 増雄  
東京都港区虎ノ門二丁目 3 番 13 号 国際電  
気株式会社内